



## Y1HGold Chemically Competent Cell

产品货号：JMC101

产品规格：

Y1HGold Competent Cell	100μl/支	保存：-80℃（3个月）
pGADT7 (control vector, 10 ng/μl)	10μl	保存：-80℃（12个月）
Carrier DNA (10 μg/μl)	100μl	保存：-20℃（12个月）
PEG/LiAc:	3ml	保存：4℃（12个月）

基因型：*MAT $\alpha$* , *ura3-52*, *his3-200*, *ade2-101*, *trp1-901*, *leu2-3, 112*, *gal4 $\Delta$* , *gal80 $\Delta$* , *met-*, *MEL1*

### 产品介绍：

Y1HGold 菌株是 Clontech 公司开发的 GAL4-AbA 酵母单杂系统用菌株，MAT $\alpha$  型，可直接转化质粒进行筛库试验。Transformation marker 为：*ura3*，*leu2*；报告基因为：*AbAr*。Y1HGold-GAL4-AbA 酵母单杂系统需要两种质粒配套使用：pAbAi 和 pGADT7。质粒 pAbAi 的筛选标志为 *URA*，用于表达 pBait-AbAi construct (1~3 个 bait DNA 序列重复串联后克隆到 pAbAi 中)；质粒 pGADT7 的筛选标志为 *LEU*，用于表达 AD(GAL4 C 端 768~881 位氨基酸)与目标蛋白 (Prey) 的融合蛋白。GAL4-AbA 酵母单杂系统原理：Aureobasidin A (AbA) 是一种环酯肽抗生素，在低浓度 (0.1-0.2 μg/ml) 下即可对酵母产生毒性。基因组中整合了 pBait-AbAi 的酵母菌株 (Bait-Reporter Yeast Strains)，当猎物蛋白 (Prey) 结合到诱饵序列 (Bait DNA) 上，GAL4 AD 就会激活 *AbAr* 的表达，从而能够在含有抗生素 AbA 的培养基上生长。*AbAr* 与营养缺陷报告基因相比具有更低背景的优点，可以降低酵母单杂假阳性发生的概率。Y1HGold 感受态细胞经特殊工艺制作，-80℃ 可保存三个月，pGADT7 质粒检测转化效率 >10<sup>4</sup> cfu/μg DNA。

### 操作方法：

1. 取 pBait-AbAi 质粒 5 μg，BstBI 或 BbsI 酶切 1 小时，回收。
2. 取 100 μl 冰上融化的 Y1HGold 感受态细胞，依次加入预冷的线性 pBait-AbAi 质粒 1-5 μg (体积不高于 15 μl)，Carrier DNA (95-100 度 5 min, 快速冰浴，重复一次) 10 μl，PEG/LiAc 500 μl 并吸打几次混匀，30 度水浴 30 min (15 min 时翻转 6-8 次混匀)。
3. 将管放 42℃ 水浴 15 min (7.5 min 时翻转 6-8 次混匀)。
4. 5000 rpm 离心 40 s 弃上清，ddH<sub>2</sub>O 400 μl 重悬，离心 30s 弃上清。
4. ddH<sub>2</sub>O 50 μl 重悬，涂 SD/-Ura 平板，29℃ 培养 72 h。
5. 挑取 5-10 个克隆，用 PCR 方法确定 pBait-AbAi 整合到 Y1HGold 基因组中，PCR 阳性菌株在 SD/-Ura 平板划线，29℃ 培养 72 h，4℃ 保存，此菌株即是 Y1HGold[Bait/AbAi] 菌株。

### 注意事项：

1. 感受态细胞最好在冰上融化。
2. 转化高浓度的质粒可相应减少最终用于涂板的菌量。
3. 同时转化 2-3 种质粒时可增加质粒的用量。
4. Y1HGold 酵母菌株对高温敏感，最适生长温度为 27-30℃；高于 31℃，生长速度和转化效率呈指数下降。



5. 菌落变粉不是污染，是酵母细胞生长中一个常见现象。当细胞在平板培养几天后，平板上的 Adenine 被酵母消耗完毕，酵母试图通过自身代谢途径合成 Adenine 以供利用，然而，有些菌株的 ADE2 基因被破坏，Adenine 合成途径受阻；又由于其 ADE4,5,6,7,8 基因均正常，所以造成中间产物 P-ribosylamino imidazole (AIR) 在细胞中积累而使菌落变为粉红色。
6. 酵母在缺陷培养基中生长速度比 YPDA 培养基慢，培养基中缺陷成分越多，生长越慢，以转化涂板为例：涂 YPDA 平板 29°C，48 h 培养可见直径 1 mm 克隆；涂 SD 单缺平板 29°C，48-60 h 培养可见直径 1 mm 克隆，涂 SD 双缺平板 29°C，60-80 h 培养可见直径 1 mm 克隆，涂 SD 三缺或四缺平板 29°C，80-90 h 培养可见直径 1 mm 克隆。